

磁場遮蔽スパッタガン

Magnetic Shields Sputter Gun

磁場シールドを行い、同一チャンバで RHEED 測定が可能
小型・低価格・お手持ちのチャンバに取付が可能

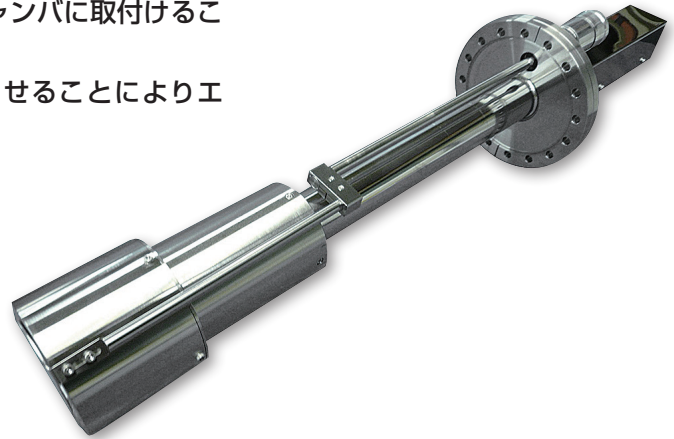
特徴

Feature

- 金属、絶縁体、磁性体、非磁性体と幅広いターゲットに対応可能
- 当社の磁気遮蔽技術を用いたスパッタガンを搭載した成膜チャンバで RHEED 測定が可能
- フランジマウントになっている為お手持ちのチャンバに取付けることができ、各種成膜実験を行うことも可能
- 内部のマグネットの位置関係及び種類を変更させることによりエロージョンの調整が容易にできる構造

用途

- ・ フィルムコーティング
- ・ 半導体デバイス
- ・ 超伝導フィルム
- ・ MEMS



仕様

Specification

ターゲット寸法	Φ50.8×3mm
スパッタ放電圧力	50Pa~0.5Pa
放電方式 RF (13.56MHz)	300W MAX
アースカバー	Φ80×72mm 78パーマロイ (磁気焼鈍処理)
取付フランジ	ICF152 *各種フランジ対応可能
全長	640mm (±50mm)
フランジ~先端寸法	370mm (±50mm)
シャッタ	Φ76mm 78パーマロイ (磁気焼鈍処理)
シャッタ機構	スイング、Z移動式 (磁場遮断の為)
冷却水	3L/MIN
ベーキング温度	110℃
オプション	RF300W電源・DC500W電源 マッチングBOXオートチューニング Z移動ステージ ノーマルマグネトロンスパッタガン

RHEED 画像 (スパッタガン搭載時)

圧力：5.8 × E-6Pa
RHEED 出力：25Kv 2A
基板：C-AL203
入射方位：10-10

